

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2004 年 6 月 24 日 (24.06.2004)

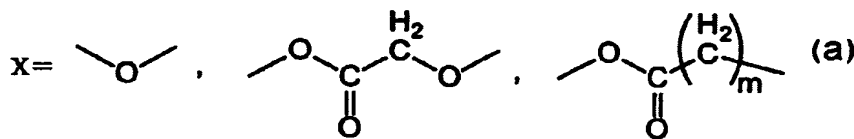
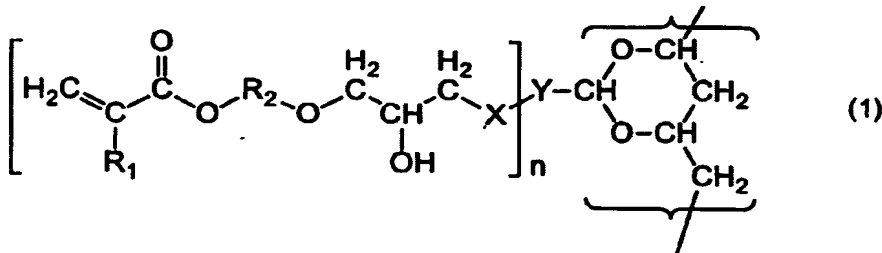
PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2004/052947 A1

- (51) 国際特許分類: C08F 8/28, 299/00, C07C 69/54, 69/734, G03F 7/038
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/014467
- (22) 国際出願日: 2003 年 11 月 13 日 (13.11.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2002-358263  
2002 年 12 月 10 日 (10.12.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋合成工業株式会社 (TOYO GOSEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒272-0012 千葉県 市川市上妙典 1603 番地 Chiba (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山田 聖悟 (YAMADA, Seigo) [JP/JP]; 〒272-0012 千葉県 市川市上妙典 1603 番地 東洋合成工業株式会社内 Chiba (JP). 高野 和浩 (TAKANO, Masahiro) [JP/JP]; 〒270-1609 千葉県 印旛郡印旛村若萩 4 丁目 2-1 東洋合成工業株式会社 感光材研究所内 Chiba (JP). 宮崎 光晴 (MIYAZAKI, Mitsuharu) [JP/JP]; 〒270-1609 千葉県 印旛郡印旛村若萩 4 丁目 2-1 東洋合成工業株式会社 感光材研究所内 Chiba (JP). 宇都宮 伸 (UTSUNOMIYA, Shin) [JP/JP]; 〒027-0088 岩手県 宮古市沢田 1-7 Iwate (JP).
- (74) 代理人: 栗原 浩之 (KURIHARA, Hiroyuki); 〒150-0012 東京都 渋谷区 広尾 1 丁目 3 番 15 号 岩崎ビル 7F 栗原国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書  
— 補正書・説明書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: NOVEL PHOTSENSITIVE RESIN BASED ON SAPONIFIED POLYVINYL ACETATE, PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, METHOD OF FORMING AQUEOUS GEL FROM THE SAME, AND COMPOUND

(54) 発明の名称: 新規なポリ酢酸ビニル鹸化物系感光性樹脂、感光性樹脂組成物及びそれを用いた含水ゲルの形成方法並びに化合物



(57) Abstract: A photosensitive resin which is a material having excellent storage stability, having an affinity for and miscibility with various compounds and high sensitivity, and capable of solidifying even when it contains water, and which gives a cured article having high sensitivity and excellent flexibility and can be evenly solidified even when it has a high water content; a photosensitive resin composition; and a novel compound. The photosensitive resin based on a saponified polyvinyl acetate has a structural unit represented by the following general formula (1): (1) wherein R<sub>1</sub> represents hydrogen or methyl; R<sub>2</sub> represents C<sub>2-10</sub> linear or branched alkylene; n is an integer of 1 to 3; X represents (a) m is an integer of 0 to 6; and Y represents an aromatic ring or a single bond.

[続葉有]

BEST AVAILABLE COPY